



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 8/12

Verkündet am
8. Mai 2014

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 028 240.7

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richter Dr. Egerer, Kätker und Dr. Freudenreich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 17. Juni 2005 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Abdecklack zum Ausbilden eines Musters und Verfahren zum
Ausbilden des Musters unter Verwendung desselben“

eingereicht worden, welche am 12. Januar 2006 in Form der DE 10 2005 028 240 A1 offengelegt worden ist. Die Patentanmeldung nimmt die Unionspriorität der koreanischen Patentanmeldung mit der Nummer KR 10-2004-0045699 vom 18. Juni 2004 in Anspruch.

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit sind von der Prüfungsstelle für Klasse C 09 D des Deutschen Patent- und Markenamts unter anderem die Druckschriften **D1** und **D3** bis **D5** ermittelt worden:

D1 DE 698 11 768 T2

D3 DE 697 18 974 T2

D4 DE 694 05 451 T2

D5 JP 03 054569 A (PATENT ABSTRACTS OF JAPAN)

Mit Beschluss in der Anhörung vom 8. Februar 2012 (Beschlussdatum 26. März 2012) hat die Prüfungsstelle für Klasse C 09 D des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung wegen fehlender Patentfähigkeit auf Grund des § 48 PatG zurückgewiesen. Als Begründung ist angegeben, der Patentanspruch 1 sei gegenüber der ursprünglichen Anmeldung unzulässig erweitert.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die beim Deutschen Patent- und Markenamt mit Schriftsatz vom 30. April 2012 eingegangene Beschwerde der Anmelderin.

Die - wie zuvor schriftsätzlich mitgeteilt - nicht zur Verhandlung erschienene Anmelderin hat zuletzt mit Schriftsatz vom 14. Januar 2013 einen neuen Hauptantrag und zwei Hilfsanträge eingereicht und sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C09D vom 8. Februar 2012 aufzuheben und das Patent mit den am 15. Januar 2013 eingegangenen Patentansprüchen 1-15 gemäß Hauptantrag,

den Beschreibungsseiten 1-12 vom Anmeldetag und den Zeichnungen, Figuren 1-3F vom Anmeldetag zu erteilen;

hilfsweise das Patent mit dem am 15. Januar 2013 eingegangenen Patentansprüchen 1-14 gemäß Hilfsantrag 1, im Übrigen wie zum Hauptantrag zu erteilen;

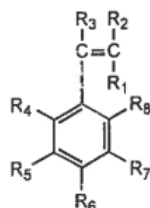
weiter hilfsweise das Patent mit dem am 15. Januar 2013 eingegangenen Patentansprüchen 1-13 gemäß Hilfsantrag 1, im Übrigen wie zum Hauptantrag zu erteilen.

Sie sieht die Gegenstände der geltenden Patentansprüche durch die Offenbarung der ursprünglichen Anmeldeunterlagen gestützt und sowohl die Neuheit als auch die erfinderische Tätigkeit vor dem Hintergrund der im Verfahren befindlichen Druckschriften gegeben.

Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 9 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 1 und 2 sind wortgleich und lauten:

1. Abdecklack zum Ausbilden oder Formgebung eines Musters, umfassend:

- einem Photo-Initiator;
- einem flüssigen Prepolymer, das eine Struktur hat, die in der chemischen Formel 1 gezeigt ist



[Chemische Formel 1]

wobei R₁, R₂ und R₃ Wasserstoff oder eine Alkylgruppe mit $\leq C_4$ sein können und wobei ein einziger Substituent der Gruppe bestehend aus R₄ bis R₈ aus der Gruppe, die aus OH, COOCH₃, COOC₂H₅, COOC₃H₇, COOC₄H₉, SOOCH₃, SOOC₂H₅, SOOC₃H₇ und SOOC₄H₉ besteht, ausgewählt wird und die übrigen Substituenten Wasserstoff sind, wobei das Prepolymer über eine Photoreaktion ein lineares Polymer ausbildet; und

- einen Photo-Säurebildner zur Aktivierung einer physikalischen Quervernetzungsreaktion des linearen Polymers.

9. Verfahren zum Ausbilden eines Musters, das aufweist:

- Ausbilden einer Ätzobjektschicht auf einem Trägermaterial;
- Aufbringen des Abdecklackes gemäß Anspruch 1 auf der Ätzobjektschicht,
- Ausbilden des Abdecklackes unter Verwendung einer Formplatte mit einem darauf ausgebildeten Abdruck; und
- Aushärten des Abdecklackes, um ein Abdecklackmuster auszubilden, während die Formplatte den Abdecklack entsprechend des Abdrucks ausbildet.

Zum Wortlaut der Unteransprüche 2 bis 8 und 10 bis 15 nach Hauptantrag wird auf den Beschwerdeschriftsatz verwiesen.

Die Hilfsanträge 1 und 2 unterscheiden sich von der Anspruchsfassung nach Hauptantrag darin, dass beim 1. Hilfsantrag, der 14 Patentansprüche umfasst, der Unteranspruch 3 gestrichen worden ist und die übrigen Unteransprüche hinsichtlich Nummerierung und Rückbezüge angepasst worden sind, beim 2. Hilfsantrag, der 13 Patentansprüche umfasst, darin, dass die Unteransprüche 3 und 4 gestrichen worden und die übrigen Unteransprüche hinsichtlich Nummerierung und Rückbezüge angepasst worden sind.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist frist- und formgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig (PatG § 73). Sie hat jedoch im Ergebnis keinen Erfolg.

1. Das Streitpatent betrifft einen Abdecklack zum Ausbilden eines Musters und ein Verfahren zum Ausbilden dieses Musters. Sie sollen im Wesentlichen die problembehafteten Beschränkungen und Nachteile des Standes der Technik vermeiden (DE 10 2005 028 240 A1: Absatz [0010]).

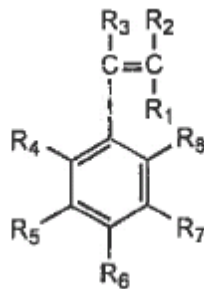
2. Eine Aufgabe der Erfindung sei es, ein Verfahren zum Ausbilden eines Musters bereitzustellen, das ein In-Plane-Druckverfahren ohne Photomasken und Belichtungseinrichtung verwendet. Als weitere Aufgabe sei die Bereitstellung eines Abdecklackes für das In-Plane-Druckverfahren zu sehen (DE 10 2005 028 240 A1: Absätze [0011] und [0012]).

3. Diese Aufgaben werden gelöst durch die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 9, die unter Einfügung einer Gliederung lauten:

M1 Abdecklack zum Ausbilden oder Formgebung eines Musters, umfassend:

M1.2 einen Photo-Initiator

M1.3 ein flüssiges Prepolymer, das eine Struktur hat, die in der chemischen Formel 1 gezeigt ist



Formel 1

- M1.3.1** wobei R_1 , R_2 und R_3 Wasserstoff oder eine Alkylgruppe mit $\leq C_4$ sein können
- M1.3.2** wobei ein einziger Substituent der Gruppe bestehend aus R_4 bis R_8 aus der Gruppe, die aus OH, COOCH₃, COOC₂H₅, COOC₃H₇, COOC₄H₉, SOOCH₃, SOOC₂H₅, SOOC₃H₇ und SOOC₄H₉ besteht, ausgewählt wird und die übrigen Wasserstoff sind
- M1.4** wobei das Prepolymer über eine Photoreaktion ein lineares Polymer ausbildet
- M1.5** einen Photo-Säurebildner zur Aktivierung einer physikalischen Quervernetzungsreaktion des linearen Polymers.

- M2** Verfahren zum Ausbilden eines Musters, das aufweist:
 - M2.1** Ausbilden einer Ätzobjektschicht auf einem Trägermaterial
 - M2.2** Aufbringen des Abdecklackes gemäß Anspruch 1 auf der Ätzobjektschicht
 - M2.3** Ausbilden des Abdecklackes unter Verwendung einer Formplatte mit einem darauf ausgebildeten Abdruck
 - M2.4** Aushärten des Abdecklackes, um ein Abdecklackmuster auszubilden, während die Formplatte des Abdecklack entsprechend des Abdrucks ausbildet.

4. Als Fachmann auf dem vorliegenden technischen Gebiet ist ein Diplom-Chemiker zu sehen, der aufgrund seiner Ausbildung und mehrjährigen Berufserfahrung, etwa in der Entwicklungsabteilung eines einschlägigen Unternehmens, über fundierte Kenntnisse sowohl der Rezeptur von Photolacken verfügt, als auch mit den Problemen und Anforderungen des Aufbringens derartiger Lackschichten bei Photolithographieverfahren vertraut ist.

5. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist hinsichtlich des Merkmals **M1.3.2** gegenüber den Ursprungsunterlagen unzulässig erweitert.

Zum einen sind die für R_4 bis R_8 als Substituenten genannten Gruppen COOCH_3 und SOOCH_3 nicht den Unterlagen vom Anmeldetag zu entnehmen. Im Absatz [0025] vom Anmeldetag ist ausgeführt, dass hydrophile Gruppen für eine der Gruppen R_4 bis R_8 stehen können. Beispielsweise können die hydrophilen Gruppen eine Gruppe von OH , COOHCH_3 , COOC_2H_5 , COOC_3H_7 , COOC_4H_9 , SOOHCH_3 , SOOC_2H_5 , SOOC_3H_7 und SOOC_4H_9 sein. Auch die zusammen mit der deutschen Übersetzung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte prioritätsbegründende Schrift KR 10-2004-0045699 offenbart denselben Fehler bei den hydrophilen Gruppen. Das Weglassen des Merkmals „hydrophil“ im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist im Rahmen der Festlegung auf die konkret bezeichneten Substituenten zulässig. Die Gruppen COOHCH_3 und SOOHCH_3 sind chemisch nicht realisierbar, da der mit Einfachbindung am Kohlenstoff gebundene Sauerstoff an zwei weitere Gruppen, nämlich Wasserstoff oder Methyl gebunden ist. Dies gilt analog für die Sulfinsäuregruppe. Der Fachmann entnimmt dieser Formulierung aufgrund seines Fachwissens entweder die freie Carbonsäure (COOH) oder den Carbonsäuremethylester (COOCH_3), die freie Sulfinsäure (SOOH) oder den Sulfinsäuremethylester (SOOCH_3). Carbonsäuren und Sulfinsäuren sind dem Fachmann als hydrophile Gruppen geläufig, weil sie in gleicher Weise wie eine Hydroxygruppe einer Verbindung Wasserlöslichkeit verleihen. Die Patentanmelderin führt demgegenüber aus, dass der Fachmann automatisch eine gedankliche Korrektur der Offenbarung vornehme, nämlich zu COOCH_3 und SOOCH_3 , da sich dann die Verbindungen in die Reihe der Ester-Verbindungen mit einer ansteigenden Zahl von Kohlenstoffatomen einreihen. Dem Fachmann ist somit keine eindeutige Offenbarung bezüglich dieser beiden denkbaren funktionellen Gruppen gegeben. Deshalb ist die Festlegung der funktionellen Gruppen auf Carbonsäure- oder Sulfinsäuremethylester nicht durch die Offenbarung vom Anmeldetag gedeckt.

Zum anderen ist das Merkmal, dass ein einziger Substituent R_4 bis R_8 aus der neun funktionelle Gruppen umfassenden Liste ausgewählt wird, während die übrigen Wasserstoff sind, in gleicher Weise nicht den Unterlagen vom Anmeldetag zu entnehmen. Der Absatz [0016] der Unterlagen vom Anmeldetag besagt, dass das flüssige Prepolymer eine Vinyl-funktionelle Gruppe und eine hydrophile Gruppe beinhaltet. Dem Patentanspruch 4 vom Anmeldetag ist zu entnehmen, dass wenigstens einer der Reste R_4 bis R_8 hydrophile Eigenschaften aufweist. Die Offenbarung für die Aussage, dass „die übrigen Wasserstoff sind“, ist in den Unterlagen vom Anmeldetag nicht zu finden. Nach Absatz [0026] der Unterlagen vom Anmeldetag kann OH für R_6 stehen, wenn R_1 , R_2 und R_3 H bedeuten. Beispielweise kann das flüssige Prepolymer Para-Hydroxystyrol sein. Beim Patentanspruch 5 vom Anmeldetag fällt die Formel für Para-Hydroxystyrol (Chemische Formel 2) durch den Rückbezug auf den Patentanspruch 2 vom Anmeldetag unter die dort gezeigte Chemische Formel 1. Damit könnten sich dem Fachmann bei der Lektüre des Gesamtzusammenhangs aufgrund seines Fachwissens Styrolerivate offenbaren, bei welchen die Vinylgruppe als einzige Substituenten Wasserstoff trägt und bei welchen die hydrophile Gruppe para-ständig zur Vinylgruppe am Benzolring sitzt. Die Ausführungen der Patentanmelderin, dass dem Fachmann Wasserstoff eindeutig für die Substituenten R_4 bis R_8 ableitbar sei, wenn sie nicht die einzige hydrophile Gruppe darstellten, dass Wasserstoff der einfachste Substituent einer Kohlenwasserstoffverbindung sei und dass die im Absatz [0026] vom Anmeldetag offenbarte Verbindung klarer Bestandteil der Erfindung sei, können nicht durchgreifen, da Wasserstoff als Substituent aus den genannten Gründen nur im Zusammenhang mit einer Vinylgruppe, die ausschließlich Wasserstoffatome als Substituenten trägt, und einer para-ständigen hydrophilen Gruppe offenbart ist.

Die weiteren Merkmale **M1**, **M1.2**, **M1.3**, **M1.4** und **M1.5** sind in den Ansprüchen 1, 2 und 9 vom Anmeldetag offenbart, das Merkmal **M1.3.1** geht aus Anspruch 3 vom Anmeldetag und aus Absatz [0025], Zeilen 3 bis 6 der Beschreibung vom Anmeldetag hervor. Die weiteren Patentansprüche nach Hauptantrag sind in den Anmeldeunterlagen wie folgt offenbart: Der Patentanspruch 2 entspricht Patentan-

spruch 5 vom Anmeldetag. Der geltende Patentanspruch 3 enthält eine Strukturformel, die am Anmeldetag nicht offenbart war und durch Analogieschluss der im Patentanspruch 6 vom Anmeldetag gezeigten Polymerisationsreaktion mit dem im Patentanspruch 2 vom Anmeldetag offenbarten Prepolymer hergeleitet ist. Der geltende Patentanspruch 4 lässt sich aus dem Patentanspruch 6 vom Anmeldetag herleiten, die Patentansprüche 5 bis 15 entsprechen den Patentansprüchen 8, 10 bis 12 und 14 bis 20 vom Anmeldetag.

6. Selbst bei Präzisierung der Merkmalsgruppe **M1.3** auf Para-Hydroxystyrol nach Patentanspruch 5 vom Anmeldetag würde dem Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 die Neuheit fehlen.

Die Merkmale „flüssiges Prepolymer“, „Photo-Säurebildner“ und „Photoinitiator“ bedürfen der Auslegung.

Ein „flüssiges Prepolymer“ im Patentanspruch 1 entspricht in chemischer Hinsicht dem einzusetzenden monomeren Styrolderivat, der Photo-Säurebildner ist gemäß geltendem Patentanspruch 5 ein Triarylsulfoniumsalz oder ein organischer Sulfoester, der Photoinitiator ist nicht anhand von Beispielen ausgeführt, dient nach Absatz [0031] der Unterlagen vom Anmeldetag jedoch der Radikalbildung.

Aus der Druckschrift **D3** ist eine Photoresistzusammensetzung mit einem Binderharz, das ein Polymer mit phenolischen Einheiten und Acetal- oder Ketalester-Einheiten umfasst (**D3**: Anspruch 1) bekannt. Das Polymer kann durch Polymerisation freier Radikale, z.B. durch Reaktion einer Vielzahl von Monomeren in Gegenwart eines Radikalinitiators gewonnen werden, wobei beispielsweise Vinylphenol und ein Acetalester oder Ketalester einer substituierten oder nicht substituierten Acrylsäure unter freien Radikalbedingungen polymerisiert werden (**D3**: Seite 17, Zeilen 10 bis 20; Merkmale **M1**, **M1.3**). Hinsichtlich des mit Hauptantrag beanspruchten Abdecklackes ist es ohne Belang, auf welche Weise die Monomeren das lineare Polymer (Merkmal **M1.4**) bilden, da die Zusammensetzung beansprucht ist und als Radikalinitiator unter anderem Azo-bis-2,2'-isobutyronitril

(AIBN) genannt ist (**D3**: Seite 18, Zeilen 22 bis 26). AIBN ist ein Photoinitiator, der auch thermisch aktiviert werden kann (Merkmal **M1.2**). Die Druckschrift **D3** offenbart auch Sulfoniumsalze als bei Lichteinwirkung Säure erzeugende Substanzen (**D3**: Seite 21, Zeilen 11 bis 21; Merkmal **M1.5**). Da der Ausdruck „umfassend“ im geltenden Patentanspruch 1 neben dem aufgeführten flüssigen Prepolymer weitere Prepolymere wie die in der Druckschrift **D3** offenbarten Acetalester oder Ketalster einer substituierten oder nicht substituierten Acrylsäure zulässt, kann die Auffassung der Patentanmelderin, dass die Copolymere der Druckschrift **D3** nicht unter den geltenden Patentanspruch 1 fallen, nicht durchgreifen.

7. Der Gegenstand des Patentanspruchs 9 beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Die Druckschrift **D5** lehrt das mit Patentanspruch 9 beanspruchte gattungsgemäße Verfahren zum Ausbilden eines Musters. In der Druckschrift **D4** ist die Lehre der Druckschrift **D5** dahingehend ausgeführt, dass ein Tropfen eines flüssigen Photoresists zwischen einem flachen Substrat und einer flachen Matrize eingegeben wird, wobei die Matrize mit einem mustermäßigen Relief in Form von Vertiefungen („recessed areas“) versehen ist, die das Komplement zu dem anzubringenden Relief in Form herausragender Teile bilden. Die Matrize und das Substrat werden aufeinander gedrückt, so dass der Photoresist sich über die ganze Substratoberfläche verbreitet. Der Photoresist wird durch Bestrahlung mit UV-Licht zum Aushärten gebracht, wobei die Bestrahlung durch das Substrat oder durch die Matrize hindurch erfolgt. Nach der Aushärtung wird die Matrize von dem Substrat entfernt, wobei auf dem Substrat das komplementäre Muster des Reliefs der Matrize in ausgehärtetem Photoresist zurückbleibt (**D4**: Seite 1, Zeile 20 bis Seite 2, Zeile 3 in Zusammenhang mit dem Abstract und den Zeichnungen (a) bis (d) der Druckschrift **D5**).

Die Druckschrift **D5** bzw. **D4** lehren damit die Merkmale **M2** und **M2.2** bis **M2.4**, wobei die Ätzobjektschicht bereits ausgebildet vorliegt und damit vorher ausgebildet werden musste (Merkmal **M2.1**). Damit beschreibt die gattungsgemäße und

vom Fachmann beachtete Druckschrift **D5** bzw. **D4** alle Verfahrensschritte nach geltendem Patentanspruch 9 und unterscheidet sich darin, dass dem einzusetzenden Lack keine Beschränkungen auferlegt sind. Nach der Druckschrift **D4** ist das Verfahren der Druckschrift **D5** wegen der Entfernung der Matrize von dem ausgehärteten Photoresist problematisch (**D4**: Seite 2, Zeilen 8 bis 12). Die Druckschrift **D4** löst das Problem durch den Ersatz einer Reliefplatte durch einen drehbaren Zylinder (**D4**: Patentanspruch 1). Die Druckschrift **D4** lehrt auch das Überziehen der Matrize mit einem hydrophobierenden Trennmittel (**D4**: Seite 5, Zeile 25 bis Seite 6, Zeile 5). Für den Fachmann stellt sich damit die Aufgabe, das Ablösen des ausgehärteten Photoresists zu erleichtern, ohne die Reliefplattenform aufgeben zu müssen. Damit würde der Fachmann einen hydrophilen Lack, wie er in der Druckschrift **D3** beschrieben ist, einsetzen, da er von einem verbesserten Ablöseverhalten des Lackes ausgehen durfte. Auch der in der Druckschrift **D3** beschriebene Lack wird auf hydrophobierte Oberflächen aufgebracht (**D3**: Seite 32, Zeilen 3 bis 5: HMDA = Hexamethyldisilazan).

Die Patentanmelderin macht hierzu geltend, dass der Fachmann keinen Anreiz gehabt habe, eine Zusammensetzung zu entwickeln, die in den Umfang der Patentansprüche 1 bis 8 fällt, wobei sie die Aufgabe in der Bereitstellung einer verbesserten Abdecklack-Zusammensetzung sieht. Mithin ist die Aufgabe nicht in einer undefinierten Verbesserung, sondern in einer Verbesserung des Ablöseverhaltens zu sehen. Zudem musste die Zusammensetzung nach Druckschrift **D3** nicht mehr entwickelt werden.

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Abdecklacks führen die Patentansprüche 6 bis 8 nach Hauptantrag die bevorzugten Mengenanteile der drei Komponenten des Abdecklackes auf, wobei die Mengenanteile des Prepolymers bei 80 bis 90 Gew.% (Patentanspruch 7), die des Photo-Initiators bei 10 bis 15 Gew.% (Patentanspruch 6) und die des Photo-Säurebildners bei 2 bis 8 Gew.-% (Patentanspruch 8) liegen. Im Vergleichsbeispiel 15 der Druckschrift **D3** (**D3**: Seite 31, Zeile 11 bis Seite 32, letzter Absatz) wird ein Verhältnis von 15 Gew.-% Resist-

komponenten und 1 Gew.-% bei Lichteinwirkung Säure erzeugender Substanz gemäß den geltenden Ansprüchen 7 und 8 gelehrt. Somit liegen die ohnehin nur ungefähren Mengenangaben der geltenden Unteransprüche 7 und 8 im einem Bereich, den der Fachmann üblicherweise wählen würde. Die Druckschrift **D1** lehrt hinsichtlich des radikalischen Ultraviolett-Polymerisationsinitiators einen Zusatz von 0,01 bis 10 Gewichtsteilen auf 100 Gewichtsteile ethylenisch ungesättigte Verbindung (**D1**: Abs. [0031], letzte sieben Zeilen), was geringfügig unterhalb des im Unteranspruch 6 beanspruchten Bereich liegt. Der Unteranspruch 6 legt den beanspruchten Bereich jedoch ebenfalls nur ungefähr fest. Auch sind keine überraschenden Eigenschaften hinsichtlich höherer Einsatzmengen an Photoinitiator erkennbar oder geltend gemacht. Die Gegenstände der auf das Verfahren bezogenen Unteransprüche 10, 11 und 13 sind in Druckschrift **D5** offenbart, wobei die Hydrophobierung der Formplatte nach Patentanspruch 10 in Druckschrift **D4** bei der entsprechenden Kreiszyklindermatrize auf Seite 5, Zeile 25 bis Seite 6, Zeile 5 gelehrt wird. Das Merkmal des geltenden Patentanspruchs 12 entspricht dem bereits erörterten Merkmal **M1.4** im geltenden Patentanspruch 1. Die Merkmale der Unteransprüche 14 und 15 beschreiben ein in der Halbleiterindustrie standardmäßig angewandtes Ätzverfahren.

Die obigen Ausführungen gelten sinngemäß auch für die wortgleichen Patentansprüche 1 und 8 nach 1. Hilfsantrag beziehungsweise 1 und 7 nach 2. Hilfsantrag und die entsprechenden Unteransprüche, die sich von denen nach Hauptantrag nur durch die Streichung von einem beziehungsweise von zwei Unteransprüchen unterscheiden.

8. Die Patentanmelderin hat sich sachlich ausführlich zu den Gründen der Zurückweisung und zu den im Prüfungsverfahren vorgebrachten Argumenten hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit geäußert und beantragt, das Patent nach Hauptantrag mit einer inhaltlich weiter gefassten Form als mit den der Zurückweisung zugrunde liegenden Patentansprüchen zu erteilen.

Somit hat die Patentanmelderin die Patenterteilung erkennbar nur im Umfang von Anspruchssätzen beantragt, die zumindest einen nicht rechtsbeständigen Anspruch enthalten. Deshalb war die Beschwerde zurückzuweisen, ohne dass noch auf die übrigen Patentansprüche gesondert eingegangen zu werden braucht (vgl. BGH v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH v. 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Feuerlein

Kätker

Egerer

Freudenreich

prä